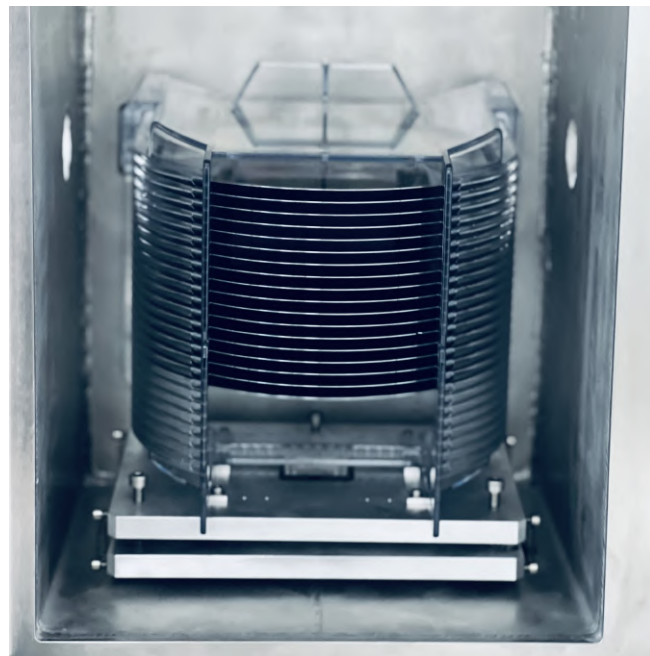
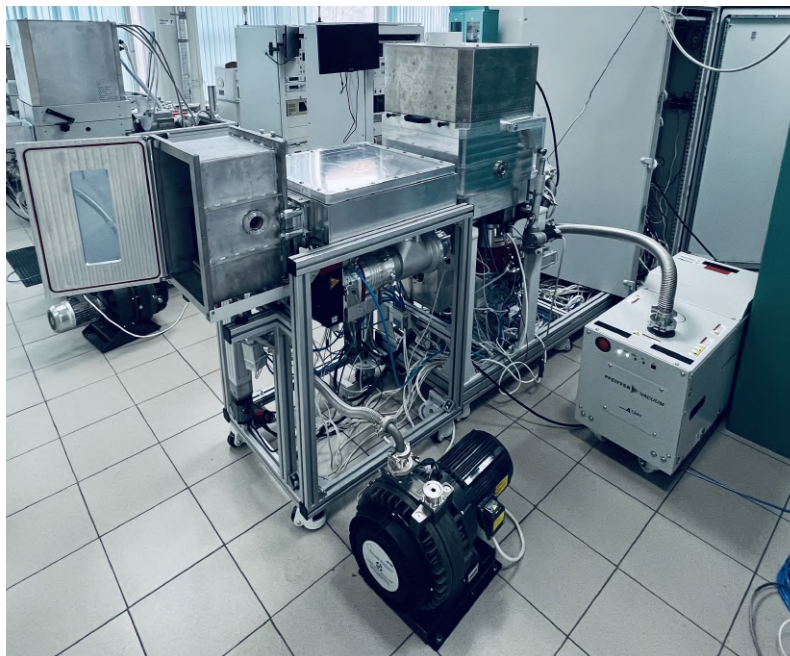


Изофаз ТМ 200-02

Установка плазмохимического осаждения диэлектрических слоев



Технические характеристики:

Характеристика	Изофаз ТМ 200-02
Скорость осаждения, нм/мин	до 100
Количество одновременно обрабатываемых пластин, шт.	1
Неравномерность травления/осаждения, %	±3
Количество источников плазмы, шт.	2
Тип источников плазмы	ICP/HDP/TCP
Максимальная мощность	18
Газовая система	В соответствии с требованиями заказчика

- Система загрузки: шлюзовая, шлюзовая из кассеты, SMIF-контейнер
- Обработка пластин Ø 76, 100, 150, 200, 300 мм
- Работа в автоматическом режиме
- Встраивание в чистую комнату
- Габариты (ШхГхВ) не более 1000x2500x2100 мм

